2012 年 11 月 13 日

報道関係者　各位

会社名　　レーザーテック株式会社
東証第二部コード６９２０
横浜市港北区新横浜２－１０－１

代表者名　代表取締役社長　　岡林　理
発表担当　企画 IR 室 室長 浅井　浩志

新製品 マスク欠陥検査装置

「MATRICS X810 シリーズ」を発表

【概　要】

レーザーテックはデザインノード20nm以降の最先端半導体デバイス用フォトマスク、およびEUV マスクに対応した高速マスク欠陥検査装置「**MATRICS X810 シリーズ**」を製品化し、11 月より受注を開始します。

【背　景】

レーザーテックは、1976 年よりフォトマスク欠陥検査装置を開発・販売し，本分野で長い歴史と経験を持つ会社です。現在販売中の MATRICS X700＆X700HiT シリーズは、そのすぐれた欠陥検出性能、低ランニングコスト、および高い可用性により、高い評価をいただき、日本、韓国、台湾、ドイツ、米国、及び中国など全世界のウェハファブやマスクショップにてご活用いただいております。

このたび、レーザーテックは、この MATRICS X700＆X700HiT シリーズの検査性能を大幅に向上させた新製品「**MATRICS X810 シリーズ**」を製品化しました。　対物レンズの高 NA 化、62.5nm から 50nm に精細化した画素サイズ、従来比 2 倍の高出力 213nm レーザー光源、及び新規設計の高剛性ステージにより、20nm という高い検出感度を実現しました。

フォトマスク、およびEUV マスクは、半導体デバイスの回路パターン原版という性格上、常に高い品質が要求されます。特に ArF リソグラフィを用いるウェハファブでは、フォトマスク上のヘイズ(成長性異物)の問題が依然未解決で、半導体のさらなる微細化に伴い、フォトマスクの欠陥検査における検査感度の向上がますます強く求められています。

また、EUV マスクは、パターン面への異物付着を防止するペリクルの装着ができないため、頻繁に異物検査が必要となり、高感度かつ、高速のマスク検査装置が求められています。

レーザーテックの MATRICS X810 シリーズは、まさにこのようなご要望にお応えすべく開発した新製品です。最先端ウェハファブにおけるマスク検査やマスクショップでの検査にご活用ください。

【特　長】

- デザインノード 20nm 以降の半導体デバイス用フォトマスク、EUV マスクに対応可能
- 新設計の高 NA 対物レンズ、50nm 画素サイズ、高出力 213nmQCW レーザー(200mW)、および高剛性ステージにより高感度化
- フォトマスク用の RSP150、RSP200、および EUV マスク用の Dual Pod に対応可能
- OHT(Overhead Hoist Transport)と連動した全自動検査が可能
- 電源・制御系統を本体に内蔵したオールインワン設計により、コンパクト化

【用　途】

- フォトマスク、EUV マスクの製造工程における出荷前検査
- ウェハファブにおけるフォトマスク、および EUV マスクの受入検査、および定期的な品質確認検査

【主な仕様】

- 検査方式　　：　マルチダイモード、シングルダイモード
- 検出感度　　：　最高感度 20 nm
  （検出感度は、欠陥種別・検査方式により異なります）
- 検査時間　　：　105 分/100x100mm エリア
- マスクサイズ　：　6 インチ



MATRICS X810 シリーズ

【標準販売価格】

- 本体価格約 13 億円（価格はモデル・仕様により異なります）

◇お問い合わせ先◇
〒222-8552　横浜市港北区新横浜 2-10-1
レーザーテック株式会社　　第三営業部　部長　森泉幸一
TEL:045-478-7337　　FAX:045-478-7333　E-mail: sales@Lasertec.co.jp